

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第2部門第4区分

【発行日】平成18年7月27日(2006.7.27)

【公開番号】特開2005-111729(P2005-111729A)

【公開日】平成17年4月28日(2005.4.28)

【年通号数】公開・登録公報2005-017

【出願番号】特願2003-346433(P2003-346433)

【国際特許分類】

B 3 2 B 9/00 (2006.01)

C 2 3 C 16/42 (2006.01)

G 0 2 F 1/1333 (2006.01)

H 0 5 B 33/02 (2006.01)

H 0 1 L 51/50 (2006.01)

【F I】

B 3 2 B 9/00 A

C 2 3 C 16/42

G 0 2 F 1/1333 5 0 0

G 0 2 F 1/1333 5 0 5

H 0 5 B 33/02

H 0 5 B 33/14 A

【手続補正書】

【提出日】平成18年6月12日(2006.6.12)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 1 6

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 1 6】

(珪素を含む透明無機薄膜層(C))

本発明において、珪素を含有する透明無機薄膜層(C)として具体的には、窒化珪素薄膜層や酸化窒化珪素薄膜層を代表例として挙げることが出来る。特には窒化珪素膜層(C1)であることが好ましい。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 9

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0 0 2 9】

【図1】本発明における実施形態例のガスバリアフィルム断面の概略図である。